

要約書

プラズマ処理装置は、処理容器内に設けられ基板が載置されるサセプタを備えている。処理容器内には処理ガスが供給され、処理ガスのプラズマが生成されるようになっている。サセプタは、基材上に形成された誘電性材料膜と、この膜上に形成された複数の凸部とを有している。サセプタの凸部は、複数の円形開口を有する開口板を介して誘電性材料膜上にセラミックスを溶射することによって形成される。

10067505.020702